Nama:	Matr -Nr ·	
Name:	 MatrMr.:	

## Klausur: Grundlagen der Elektronik SS 23

## Kurzfragen ohne Unterlagen (Bearbeitungszeit: 30 min)

- 1) Die Steilheit eines MOSFETs kann erhöht werden, wenn man
- 2) Welche der Aussagen zu einem idealen pn-Übergang mit angelegter Spannung U sind zutreffend?
- Skizzieren Sie in den vorbereiteten Diagrammen rechts die örtlichen Verläufe der Raumladungsdichte  $\rho(x)$ , des elektrischen Feldes E(x) und des Bändermodells W(x) in der angedeuteten, idealen Metall-Oxid-p-Halbleiterstruktur für den Fall der Inversion. Beschriften Sie im Bändermodell die Fermienergien im Metall ( $W_{\rm FM}$ ) und im Halbleiter ( $W_{\rm FHL}$ ), die Leitungs- und Valenzbandkantenenergie ( $W_{\rm L}$  und  $W_{\rm V}$ ), die Eigenleitungsenergie ( $W_{\rm i}$ ) sowie qU (U: angelegte Spannung). Welches Vorzeichen muss U aufweisen?
- 4) Wir betrachten den Konzentrationsverlauf der Minoritätsladungsträger  $p_n(x)$  in der neutralen Basis ( $x_2$  bis  $x_3$ ) eines pnp-Transistors.
  - a) Geben Sie <u>rechts oben</u> die Minoritätsladungsträgerkonzentrationen  $p_n(x = x_2)$  in Abhängigkeit der Emitter-Basis-Spannung  $U_{eb}$  sowie  $p_n(x = x_3)$  in Abhängigkeit der Kollektor-Basis-Spannung  $U_{eb}$  formelmäßig an:
  - Skizzieren Sie  $p_n(x)$  in dem vorbereiteten Diagramm (<u>rechts unten</u>). Vernachlässigen Sie die Variation der Verarmungszonenbreiten mit der Spannung. Markieren Sie die Verläufe mit dem Buchstaben der Teilaufgaben (b) bzw. c)):
- 5) Gegeben ist eine ideale Metall-Isolator-Halbleiter-Struktur (<u>unten, Bild a</u>) mit gleichen Austrittsarbeiten von Halbleiter und Metall sowie in den <u>Bildern c</u>) bis e) die zugehörigen Bändermodelle für drei Arbeitspunkte (Anreicherung, Verarmung, Inversion). Um welchen Halbleitertyp handelt es sich?
  - Zeichnen Sie für hohe Frequenzen den  $C(U_g)$ -Verlauf in das Diagramm (<u>Bild b</u>). Markieren Sie die jeweiligen Arbeitspunkte der drei angegebenen Bändermodelle mit dem zugehörigen Buchstaben c) bis e) in der  $C/C_i(U_g)$ -Kennlinie.
- 6) Welche der Aussagen zu dem gezeigten Bändermodell mit den Bandkanten  $W_V$  und  $W_L$  sind richtig? Markieren Sie an den Pfeilen <u>rechts</u> die Quasi-Ferminiveaus  $W_{Fn}$  für die Elektronen bzw.  $W_{Fp}$  für die Löcher.
- 7) Beschriften Sie im nebenstehenden Diagramm die Achsen (ausführliche Bezeichnung, nicht nur Formelzeichen). Markieren Sie die Leitungs- und die Valenzbandkante ( $W_L$ ,  $W_V$ ). Ist der zugehörige Halbleiter (richtiges bitte ankreuzen)

direkt oder
indirekt?

- 8) Ergänzen Sie die folgenden Aussagen zu den Eigenschaften zweier bis auf ihre effektive Elektronenmasse im Leitungsband ( $m^*_{L,A} < m^*_{L,B}$ ) identischer Halbleiter A und B in den punktierten Bereichen rechts durch ">", "<" oder "=".
- 9) Welche der Aussagen zur Kapazität C einer pn-Diode mit abruptem Übergang, homogenen Dotierungen und Vorspannung  $U_0$  zwischen p- und n-Bereich sind zutreffend?
- 10) Gegeben ist das Bändermodell W(x) von dotiertem Silizium. Geben Sie den Dotierungstyp an. Skizzieren Sie die Zustandsdichten der Elektronen im Leitungsband und der Löcher im Valenzband D(W) in parabolischer Näherung, sowie die Fermi-Verteilung f(W) und die Elektronen- und Löcherkonzentrationen im Leitungs- bzw. Valenzband n(W), p(W) in den vorbereiteten Vorlagen unten.

Matrikelnr: Name:

## Klausur: Grundlagen der Elektronik SS 23

Aufgaben ohne Unterlagen (Bearbeitungszeit: 2 Std.)

Bemerkung: Bei Berechnungen ist grundsätzlich auch der Rechenweg nachvollziehbar anzugeben.

**Konstanten**:  $q = 1,6\cdot 10^{-19}$  As;  $k = 1,38\cdot 10^{-23}$  J/K =  $8,6\cdot 10^{-5}$  eV/K;  $m_0 = 9,1\cdot 10^{-31}$  kg;  $c = 3\cdot 10^8$  m/s;  $h = 6,63\cdot 10^{-34}$  Js;  $\epsilon_0 = 8,85\cdot 10^{-12}$  As/(Vm);  $\mu_0 = 1,26\cdot 10^{-6}$  Vs/(Am);  $N_A = 6,02\cdot 10^{23}$  Atome/mol.

$$N = N_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2}; \quad n_i^2 = np = N_L N_V \exp\left(-\frac{W_G}{kT}\right); \quad n + N_A^- = p + N_D^+$$

$$N_A^- = N_A \left(\frac{p_1}{p + p_1}\right); \quad p_1 = N_1 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{W_A - W_V}{kT}\right); \quad T_0 = 300 \text{ K}.$$

- 1) Ein Halbleiter ist homogen mit Akzeptoren der Konzentration  $N_A$  dotiert ( $N_D = 0$ ) und die effektiven Zustandsdichten der freien Ladungsträger (p, n) sind gleich groß, also  $N_V = N_L = N$  mit  $N_0 = 8.5 \cdot 10^{17}$  cm<sup>-3</sup>. Die gemessene Löcherkonzentration  $p(T_0/T)$  ist in <u>Abb. 1</u> dargestellt.
  - a) Markieren Sie in <u>Abb. 1, links</u> die Temperaturbereiche, in denen die Akzeptoren vollständig  $(N_A^- = N_A)$  oder unvollständig  $(N_A^- << N_A)$  ionisiert sind, bzw. der Halbleiter eigenleitend ist  $(p = n_i)$ . Nähern Sie den Verlauf  $p(T_0/T)$  in den drei Bereichen durch Geraden und skizzieren diese.

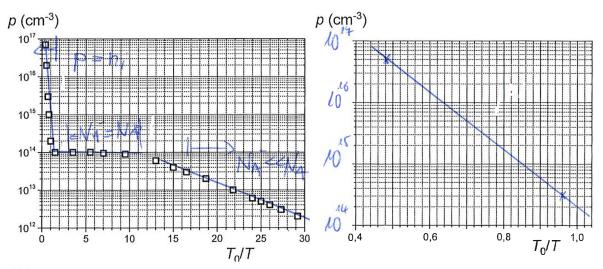


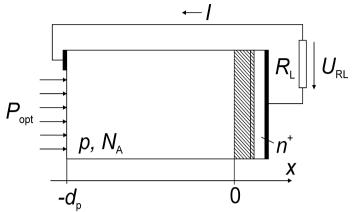
Abb. 1

1 b) 
$$N_{L} = N_{V} = N \rightarrow n_{1}^{2} = N^{2} \exp\left(-\frac{M_{L}}{M_{T}}\right) \Rightarrow D = N_{1} = N_{0} \left(\frac{T_{0}}{T_{0}}\right)^{-3/2} \exp\left(-\frac{M_{L}}{2RT_{0}}\right) T_{0}$$

P  $\left(\frac{T_{0}}{T_{0}}\right) = N_{0} \left(\frac{T_{0}}{T_{0}}\right)^{-3/2} \exp\left(-\frac{M_{0}}{2RT_{0}}\right) T_{0}\right) P\left(\frac{T_{0}}{T_{0}}\right) = \frac{1}{16} \frac{1}{16} \frac{3}{16} \frac{3}{16} \frac{1}{16} \frac{1}{$ 

2) <u>Abb. 2</u> zeigt eine  $pn^+$ -Diode ( $n_i = 5 \cdot 10^{10}$  cm<sup>-3</sup>), die bei  $T_0 = 300$  K als Solarzelle betrieben wird, d. h. Bestrahlung mit einer Leistung  $P_{\text{opt}}$  durch das p-Gebiet ( $N_A = 7 \cdot 10^{16}$  cm<sup>-3</sup>) führt zu

einer Photostromdichte  $J_{\rm ph}$ . Thermische Generation von Ladungsträgern in der Verarmungszone (Abb. 2, schraffierter Bereich) und ein Spannungsabfall über den Bahngebieten können vernachlässigt werden. Der Strom I ist nahezu vollständig durch die Elektronen bestimmt. Die Elektronenkonzentration  $n_{\rm p}(x)$  bei x=0 ist gegeben durch:



$$n_{\rm p} = n_{\rm p0} \exp\left(\frac{q U_{\rm RL}}{k T}\right)$$

soll zwischen den beiden Fällen

Der Kontakt zum  $n^+$ -Bahngebiet ist ideal ohmsch. Am Rückkontakt der Diode, d.h. bei  $x = -d_p$ ,

(I) 
$$n_{\rm p}(-d_{\rm p}) - n_{\rm p0} = 0$$
 (idealer Rekombinationskontakt);

Abb. 2

(II) 
$$\frac{dn_p}{dx}\Big|_{x=-d_p} = 0$$
 (verschwindende Oberflächenrekombination).

unterschieden werden. Ermitteln Sie für die beiden Fälle (I) und (II) die Leerlaufspannung  $U_{\rm oc}$  der Diode formelmäßig in Abhängigkeit von den gegebenen Größen.

- a) Berechnen Sie für die Elektronen im p-Bahngebiet den Diffusionskoeffizienten  $D_{\rm n} = \mu_{\rm n} k T/q$  sowie die Diffusionslänge  $L_{\rm n} = (D_{\rm n} \tau_{\rm n})^{1/2}$  und überprüfen Sie unter Verwendung der Zahlenwerte:  $\mu_{\rm n} = 200~{\rm cm^2/Vs}$ ;  $\tau_{\rm n} = 10~{\rm \mu s}$ ;  $d_{\rm p} = 7~{\rm \mu m}$ , dass  $d_{\rm p} << L_{\rm n}$ .
- b) Stellen Sie die Differenzialgleichung auf, die im eingeschwungenen Zustand und ohne Bestrahlung ( $P_{\text{opt}} = 0$ ) den Verlauf von  $n_p(x)$   $n_{p0}$  im p-Bahngebiet beschreibt. Nutzen Sie die Kontinuitätsgleichung (1) mit der Diffusionsstromdichte-Gleichung (2):

(1) 
$$\frac{1}{D_{\rm n}} \frac{\mathrm{d}n_{\rm p}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\mathrm{q}D_{\rm n}} \frac{\mathrm{d}J_{\rm n}}{\mathrm{d}x} - \frac{n_{\rm p} - n_{\rm p0}}{L_{\rm n}^2}$$
; (2)  $J_{\rm n} = \mathrm{q}D_{\rm n} \frac{\mathrm{d}n_{\rm p}}{\mathrm{d}x}$ 

Lösen Sie die Differenzialgleichung unter Verwendung des Ansatzes:

$$n_{\rm p}(x) - n_{\rm p0} = A \sinh\left(\frac{x}{L_{\rm n}}\right) + B \sinh\left(\frac{x + d_{\rm p}}{L_{\rm n}}\right)$$

und den Randbedingungen, wobei bei  $x = -d_p$ , zwischen den beiden Fällen (I) und (II) zu

- unterscheiden ist. Ermitteln Sie hierfür A und B formelmäßig. (Hinweis:  $\sinh'(y) = \cosh(y)$ ;  $\cosh'(y) = \sinh(y)$ ;  $\sinh(0) = 0$ ;  $\cosh(0) = 1$ )
- c) Für die Dunkelstromdichte  $J_{\rm d}$  ergibt sich aus dem Verlauf der Elektronenkonzentration aus b) eine Diodenkennlinie der Form  $J_{\rm d} = J_0 \{ \exp[q U_{\rm RL}/(kT)] 1 \}$ . Ermitteln Sie  $J_0$  formelund zahlenmäßig für die beiden Fälle (I) und (II). Nähern Sie hierbei mit der unter a) gefundenen Abschätzung für  $d_{\rm p}/L_{\rm n}$  gemäß sinh  $(y) \approx y$ ,  $\cosh(y) \approx 1 + y^2/2$  und  $1/(1 + y^2) \approx 1 y^2/2$  für y << 1. Nutzen Sie, dass im Bahngebiet Elektronen und Löcher im thermischen Gleichgewicht sind  $(n_{\rm p0}p_{\rm p0} = n_{\rm i}^2)$  und:  $n_{\rm i} = 1 \cdot 10^{10}/{\rm cm}^3$ ;  $N_{\rm A} = 4 \cdot 10^{18}/{\rm cm}^3$ .
- ci) Bestimmen Sie mit  $|J_{\rm ph}|=1~{\rm mA/cm^2}$  den Spannungsabfall  $U_{\rm RL}=U_{\rm oc}$  bei Leerlauf  $(R_{\rm L}=0)$  formel- und zahlenmäßig für die beiden Fälle (I) und (II).

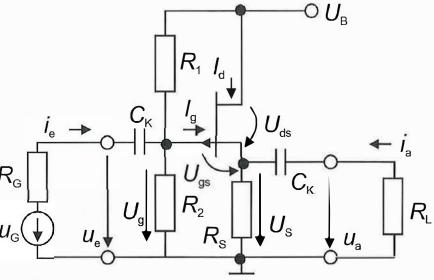
$$|A| = \frac{|A_{h}|}{q} = \frac{|A_{$$

3) Analysieren Sie die Schaltung in Abb. 3a. Der Transistor ist durch das Kennlinienfeld in Abb. 3b charakterisiert. Folgende Betriebsparameter sind gegeben:

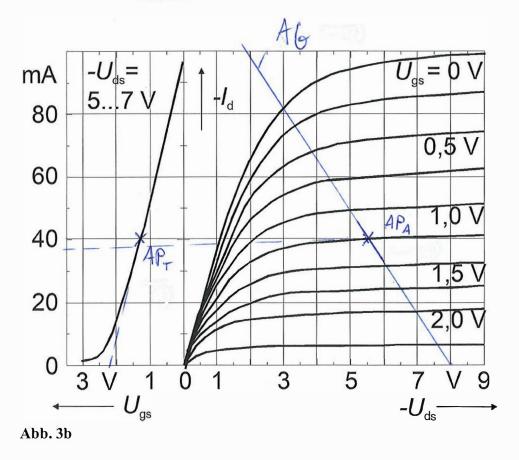
$$U_{\rm B} = -8 \text{ V}, \ U_{\rm ds} = -5.5 \text{ V},$$
 
$$U_{\rm gs} = 1.25 \text{ V}, I_{\rm g} \approx 0,$$
 
$$R_{\rm l} = 90 \text{ k}\Omega,$$

$$R_{\rm G} = 10 \text{ k}\Omega$$
,

$$R_{\rm L} = 2 \text{ k}\Omega.$$







a) Welcher Transistortyp liegt vor? Zeichnen Sie das Gleichstromersatzschaltbild. Tragen Sie die Arbeitspunkte in das Transfer- (AP<sub>T</sub>) und Ausgangskennlinienfeld (AP<sub>A</sub>) sowie die Arbeitsgerade (AG) in das Ausgangskennlinienfeld (**Abb. 3b**) ein. Lesen Sie  $I_d$  ab und ermitteln Sie  $U_S$ ,  $U_g$  und die Widerstände  $R_2$  und  $R_S$  sowie  $I_d$  ( $U_{ds} = 0$ ).

